

# Suporte Para Wafer De Silício Em Ptfé Para Processos De Ataque Ácido E Limpeza Personalizável De 2, 4, 6 E 8 Polegadas Resistente A Altas Temperaturas

Número do item: PL-CP158



## introdução

Suportes de wafer de silício em PTFE de alta pureza projetados para processos extremos de ataque ácido e limpeza. Otimizados para wafers de 2 a 8 polegadas, esses transportadores robustos e personalizáveis garantem manuseio livre de contaminação e estabilidade térmica nos ambientes de fabricação de semicondutores mais exigentes para compras B2B.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Ataque Químico para Semicondutores	Manuseio de wafers em soluções concentradas de HF ou BOE (Ataque de Óxido Tamponado) para remover camadas dielétricas.	Excepcional resistência a ácidos agressivos garante durabilidade a longo prazo do transportador.
Processos de Limpeza RCA	Utilização de soluções SC-1 e SC-2 em altas temperaturas para remover contaminantes orgânicos e metálicos.	Alta estabilidade térmica evita a deformação durante banhos oxidativos em alta temperatura.
Produção de Células Fotovoltaicas	Texturização e limpeza de wafers de silício durante a fabricação de células solares de alta eficiência.	Projeto robusto lida com a produção industrial de alto volume com confiabilidade consistente.
Fabricação de MEMS	Fixação segura de substratos durante processos complexos de ataque por íons reativos profundos e liberação úmida.	Ranhuradas usinadas com precisão protegem estruturas micromecânicas delicadas de danos por contato.
Limpeza por Ataque Piranha	Processamento de wafers em uma mistura de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio para remover compostos orgânicos pesados.	Os materiais são imunes a ataques oxidativos fortes, evitando a degradação do equipamento.
Pesquisa em Nanotecnologia	Manuseio especializado de substratos personalizados em deposição química de vapor experimental ou processamento em fase líquida.	Personalização completa permite suporte para tamanhos de wafer não padrão e geometrias exclusivas.
Montagem de Optoeletrônica	Limpeza de wafers de safira ou GaAs antes do crescimento epitaxial ou deposição de filme fino.	A pureza do material PTFE elimina o risco de interferência de traços de metal em dispositivos ópticos.

Categoria de Especificação	Detalhes do Parâmetro para PL-CP158	Disponibilidade/Opções
Série de Modelo	Transportador de Wafer de Silício PL-CP158	Projetos Padrão e Personalizados
Material Principal	PTFE (Politetrafluoroetileno) de Alta Pureza	Opções de PFA Disponíveis Mediante Solicitação
Tamanhos de Wafer Compatíveis	2 polegadas, 4 polegadas, 6 polegadas, 8 polegadas	Totalmente Personalizável para qualquer diâmetro
Configuração de Ranhuradas	Capacidade e passo são definidos por projeto	Personalizado conforme especificação do usuário
Faixa de Temperatura	Operacional de níveis criogênicos até 260°C	Personalização dependente do processo
Resistência Química	Toda a gama de ácidos, bases e solventes	Compatibilidade química universal
Método de Fabricação	Usinagem de Precisão CNC de 5 Eixos	Geometria personalizada disponível
Recursos de Drenagem	Portas de drenagem inferiores/laterais personalizáveis	Otimizado para taxas de fluxo de banho específicas

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
<b>Categoria de Especificação</b>	<b>Detalhes do Parâmetro para PL-CP158</b>	<b>Disponibilidade/Opções</b>
<b>Projeto de Alça</b>	Alças destacáveis ou integradas manuais/robóticas	Personalizado para compatibilidade com ferramentas
<b>Grau de Pureza</b>	Análise de traços e grau semicondutor	Materiais de alta pureza certificados